

大見研究室 和文 論文リスト

1987年

- 36-1(P) 大見忠弘、室田淳一、三井泰裕、杉山和彦、川崎健弘、河野博明、大森宣典、松坂一紀、「ガス純化技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.4、高性能化プロセス技術、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.1-30、1987年1月。
- 37-1(P) 三井泰裕、大見忠弘、室田淳一、杉山和彦、川崎健弘、河野博明、大森宣典、松坂一紀、「超高純度ガス評価技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.4、高性能プロセス技術、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.33-61、1987年1月。
- 38-1(P) 黒宮茂、光地哲伸、大見忠弘、「ガス供給系の高純度化」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.4、高性能化プロセス技術、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.65-97、1987年1月。
- 39-1(P) 都田昌之、菅野洋一、大見忠弘、「配管系ガス置換特性」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.4、高性能化プロセス技術、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.101-129、1987年1月。
- 40(P) 大見忠弘、馬場吉康、三好肇、宮崎清彦、鈴木俊昭、八木沢茂、菅野洋一、村岡晃、「クリーンガスボンベ」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.4、高性能化プロセス技術、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.133-157、1987年1月。
- 41-1(P) 柴田直、桑原英司、大見忠弘、斉藤達之、清田哲司、「DC-RF結合バイアススパッタ技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.4、高性能化プロセス技術、プロシーディング(リアライズ社)、pp.181-202、1987年1月。
- 42-1(P) 大見忠弘、菅野洋一、畑山忠弘、森川栄久、須磨克博、森田瑞穂、「薄い酸化膜生成技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.4、高性能化プロセス技術、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.205-229、1987年1月。
- 43-1(P) 黒宮茂、吉武春二、岩淵浩志、佐藤源一、大見忠弘、「超高純度エピタキシャル成長技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.4、高性能化プロセス技術、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.233-251、1987年1月。
- 44(P) 大見忠弘、御子柴宣夫、「電子デバイス加工における環境制御」、'87 精密測定技術シンポジウム、((社)日本能率協会)、1987年2月。
- 45(P) 大見忠弘、御子柴宣夫、「究極のクリーンルーム」、最先端のスーパークリーンテクノロジーに関する講演会、(環境技術研究協会)、1987年2月。
- 46(M) 大見忠弘、御子柴宣夫、「超微細物質科学の学問的体系化を目指す」、日経エレクトロニクス 1987年4月6日号 No.418、(日経マグロウヒル社)、pp.269-271、1987年4月。
- 47(P) 大見忠弘、御子柴宣夫、坪内和夫、室田淳一、竹浪敏人、福田宗治、下田潔、「システムとしてのクリーンルームテクノロジー」、第6回空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会予稿集、((社)日本空気清浄協会)、pp.123-137、1987年5月。
- 48(P) 大見忠弘、「LSI製造技術における放出ガスの問題」、日本金属学会シンポジウム予稿集、pp.31-49、1987年6月。
- 49-1(P) 矢部江一、石川浩朗、水庭哲夫、田中和光、大見忠弘、「精密抵抗率測定」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.5、高性能化プロセス技術Ⅱ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.1-23、1987年7月。
- 50-1(P) 藤崎芳男、平塚豊、大見忠弘、「省電力形クリーンドラフト」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.5、高性能化プロセス技術Ⅱ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.145-167、1987年7月。

- 51-1(P) 大見忠弘、三島博之、水庭哲夫、阿部光夫、「ウェハ表面吸着分子分析」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.5、高性能化プロセス技術Ⅱ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.213-232、1987年7月。
- 52-1(P) 安井富春、水庭哲夫、三島博之、阿部光夫、大見忠弘、「パーティクルフリー洗浄・乾燥技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.5、高性能化プロセス技術Ⅱ、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.261-293、1987年7月。
- 53(P) 大見忠弘、「ウルトラクリーンテクノロジーとデバイス技術の将来」、'87マイクロシンポジウム、超LSI用レジストの現状と将来の展望、((社)高分子学会)、pp.9-14、1987年7月27日。
- 54-1(M) 大見忠弘、「ppt への挑戦—ppt の不純物濃度に挑戦する半導体用ガス配管システム」、日経マイクロデバイス 1987年7月号、No.25、(日経マグロウヒル社)、pp.98-119、1987年7月。
- 55(M) 大見忠弘、「あるべき姿を求めて」、日立評論7月号一家一言(日立評論社)、1987年7月。
- 56(P) 畑山忠弘、菅野洋一、大見忠弘、須磨克博、田中一成、森田瑞穂、「超高清浄酸化による薄い酸化膜形成」、電子情報通信学会技術研究報告(シリコン材料・デバイス研究会)、論文番号 SDM87-56、pp.3-8、1987年8月。
- 57(P) 桑原英司、大見忠弘、柴田直、斉藤達之、杉山和彦、「RF-DC結合バイアススパッタ法によるAl薄膜の形成」、電子情報通信学会技術研究報告(シリコン材料・デバイス研究会)、論文番号 SDM 87-69、pp.43-48、1987年8月。
- 58(B) 大見忠弘、「半導体の技術開発の現状」、先端技術環境安全要覧、(株)サイエンスフォーラム、pp.31-40、1987年8月。
- 59(M) 大見忠弘、御子柴宣夫、「究極のクリーンルーム—極限微細化電子回路の実現を目指して—」、東北大学電通談話会記録、第56巻第1号、(東北大学電気通信研究所)、pp.22-32、1987年9月。
- 60(B) 大見忠弘、御子柴宣夫、「究極のクリーンルーム」、超精密加工及び計測に関する研究(Ⅲ)((社)日本機械工業連合会)、1987年9月。
- 61-1(M) 大見忠弘、石原良夫、森田瑞穂、「ppt への挑戦—Heリーク・ディテクタを採用、不純物混入をpptレベルに追い込む」、日経マイクロデバイス 1987年9月号、No.27、(日経マグロウヒル社)、pp.124-132、1987年9月。
- 62-1(M) 大見忠弘、杉山和彦、「ppt への挑戦—ガス供給系で最大の課題は水分除去」日経マイクロデバイス 1987年10月号、No.28、(日経マグロウヒル社)、pp.100-108、1987年10月。
- 63(P) 大見忠弘、「超々LSI開発における材料開発の重要性」、山形大学昭和62年度公開講座、新素材とスーパークリーンテクノロジー、(山形大学産業研究所)、1987年11月。
- 64-1(M) 大見忠弘、杉山和彦、中原文生、奥村毅、菅野洋一、津田格、「ppt への挑戦—ガスに入る不純物削減は配管の放出ガス抑制がカギ」、日経マイクロデバイス 1987年11月号、No.29、(日経マグロウヒル社)、pp.88-96、1987年11月。
- 65(P) 大見忠弘、川崎健弘、柴田直、斉藤達之、桑原英司、新田雄久、「RF-DC結合バイアススパッタによるCu薄膜の形成」、電気学会研究会資料(電子材料研究会資料)、論文番号 EFM-87-24、pp.21-28、1987年11月。
- 66(P) 吉武春二、奥村毅、愛川浩功、室田淳一、大見忠弘、「ウルトラクリーンテクノロジーを用いた高品質エピタキシャルシリコン層の形成」、電気学会研究会資料(電子材料研究会)、論文番号 EFM-87-25、pp.29-35、1987年11月。
- 67(F) 大見忠弘、御子柴宣夫、「究極のクリーンルーム」、環境技術 Vol.16、No.12、(環境技術研究協会)、pp.823-832、1987年12月。
- 68(P) 大見忠弘、柴田直、「導電性レジストを用いたVLSIプロセス」、フォトポリマー懇話会講演会、(千葉大学工学部画像応用工学科)、1987年12月。
- 69(P) 大見忠弘、「0.1 μ m デバイスの加工と物理」、極限構造電子物性第151委員会、(日本学術振興会)、1987年12月。